Атомная и электронная структура кремниевых и кремний-металлических наночастиц Si₂₀, Si₂₀, NaSi₂₀ и KSi₂₀

© Н.А. Борщ[¶], Н.С. Переславцева, С.И. Курганский

Воронежский государственный университет, 394006 Воронеж, Россия

(Получена 23 марта 2006 г. Принята к печати 26 апреля 2006 г.)

Представлены результаты оптимизации атомной структуры и расчета электронной структуры кластеров Si₂₀, Si₂₀, NaSi₂₀ и KSi₂₀. Для расчетов использовались полуэмпирические методы PM3 и AM1. Показано, что атомы Na и K стабилизируют фуллереноподобную кремниевую структуру. Анализируется влияние геометрии кластеров на их электронную структуру.

PACS: 36.40.Mr, 61.46.Bc, 61.48.+c, 73.22.-f

1. Введение

После открытия в 1985 году фуллерена С₆₀ [1] появились предположения, что кремний также может образовывать сфероидальные или по крайней мере замкнутые кластеры. Долгое время синтезировать такие структуры не удавалось, и только в 2001 году японские ученые сообщили, что им удалось получить устойчивые кластеры из 12-ти и 18-ти атомов кремния с замкнутой структурой [2]. Для стабилизации кремниевой решетки внутрь ее помещается атом переходного металла. Структура полученных кластеров представляет собой шестиугольную призму в случае кластера MeSi₁₂ (Me металл) или две шестиугольных призмы с общим основанием в случае кластера Me₂Si₁₈. В центре призмы находится атом металла. Такие кластеры предположительно могут служить "строительными кирпичиками" при получении кремниевых нанотрубок — аналогов углеродных трубок [3].

Ранее (в 1964 году) были синтезированы соединения, структура которых построена из замкнутых кластеров кремния, в которые инкапсулированы атомы щелочных металлов — кремниевые клатраты [4]. Клатратные кристаллы кремния представляют собой упорядоченную структуру, построеную из правильных сфероидов $Si_{20} + Si_{24}$ или $Si_{20} + Si_{28}$. В первом случае получается структура I типа — Si_{46} , во втором структура II типа — Si_{136} . Кремниевые клатраты Si_{46} являются крайне неустойчивыми и до сих пор не синтезированы. Атомы металлов необходимы для стабилизации структуры [4]. Однако изолированные кластеры, из которых построена решетка клатратов, до сих пор получить не удалось.

Изучение структурных и электронных свойств кластеров Si_{20} , Si_{24} и Si_{28} крайне важно для понимания механизма образования клатратных кристаллов. Кроме того, они представляют значительный интерес и как самостоятельные объекты, поскольку свойства их атомной и электронной структуры сильно зависят как от числа атомов кремния, так и от сорта стабилизирующих атомов металла. Это значит, что можно получать структуры с заданными свойствами путем выбора атома металла или же изменяя количество атомов Si, образующих кремниевый сфероид.

В данной работе мы представляем результаты оптимизации атомной структуры и расчета электронной структуры кластеров Si₂₀, Si₂₀, NaSi₂₀ и KSi₂₀. Для оценки адекватности расчетов приводится сопоставление рассчитанного электронного спектра кластера Si₂₀ с экспериментальными данными [5]. К сожалению, об экспериментах по исследованию атомной структуры рассматриваемых нами кластеров в литературе не сообщается.

2. Метод расчета

Расчеты проводились полуэмпирическими методами AM1 (Austin Model 1) и PM3 (Parameterised Model 3) [6-8]. Метод РМЗ является более современной модификацией метода AM1. Основа этих методов приближение МО ЛКАО (молекулярная орбиталь линейная комбинация атомных орбиталей). Кроме того, используется приближение, в котором пренебрегается двухатомным дифференциальным перекрытием (neglect of diatomic differential overlap — NDDO) [9]. При создании методов AM1 и PM3 учитывалось значительно большее количество параметров, чем в других полуэмпрических методах, что обеспечивает более адекватные результаты расчетов. В методе AM1 параметры были определены по 100 молекулам (от 7 до 21 параметра на элемент), а в методе РМЗ параметры оптимизированы по 657 молекулам (18 параметров на элемент). Как было показано нами в работе [10], расчет электронной структуры кремниевого кластера Si₁₂ методом РМЗ позволяет получить результаты, которые согласуются с экспериментальными данными значительно лучше, чем результаты расчета методом *ab initio* на базисе 6-21G.

Исходя из этого для расчетов атомной и электронной структуры кластеров Si_{20} и Si_{20}^- мы использовали метод РМЗ. Для расчета кластеров $NaSi_{20}$ и KSi_{20} метод РМЗ неприменим, поскольку в нем не заложены параметры

[¶] E-mail: ssd18@phys.vsu.ru

для расчета систем, содержащих атомы щелочных металлов. Поэтому для кремний-металлических кластеров мы использовали метод AM1. Анализ распределения заряда в кластерах проводился по методу Малликена.

В данных полуэмпирических методах полная энергия кластера вычисляется следующим образом:

$$E = 2\sum_{\mu} \sum_{\nu} \mathbf{P}_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + 2\sum_{\mu} \sum_{\nu} \sum_{\lambda} \sum_{\sigma} \mathbf{P}_{\mu\nu} \mathbf{P}_{\lambda\sigma} \left(\langle \mu\nu | \lambda\sigma \rangle - \frac{1}{2} \langle \mu\nu | \lambda\sigma \rangle \right),$$
(1)

где

$$h_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}(r_{i})h\chi_{\nu}(r_{i})dV_{i},$$

$$\langle \mu\nu|\lambda\sigma\rangle = \iint \chi_{\mu}(r_{i})\chi_{\nu}(r_{i})\frac{1}{r_{ij}}\chi_{\lambda}(r_{j})\chi_{\sigma}(r_{j})dV_{i}dV_{j},$$

$$\langle \mu\lambda|\nu\sigma\rangle = \iint \chi_{\mu}(r_{i})\chi_{\lambda}(r_{i})\frac{1}{r_{ij}}\chi_{\nu}(r_{j})\chi_{\sigma}(r_{j})dV_{i}dV_{j},$$

$$P_{\mu\nu} = \sum_{j}^{\text{occup.MO}} c_{j\mu}c_{j\nu}$$

 матрица плотности, которая описывает распределение электронной плотности по молекуле (закрытые оболочки):

$$\rho(r) = 2 \sum_{j} \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{j\mu} c_{j\nu} \chi_{\mu}(r) \chi_{\nu}(r)$$
$$= 2 \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} \chi_{\mu}(r) \chi_{\nu}(r). \qquad (2)$$

Выделяя вклады атомных орбиталей атомов I и J из (2), получим

$$\rho(r) = 2 \sum_{I} \sum_{J} \sum_{\alpha} \sum_{\beta} P_{\alpha\beta}(I, J) \chi_{\alpha}(r) \chi_{\beta}(r),$$

$$\alpha \in I, \quad \beta \in J.$$
(3)

После интегрирования левой и правой части (3) с учетом того, что атомные орбитали нормированы, получается

$$N = 2\sum_{I}\sum_{J}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}P_{\alpha\beta}(I,J)S_{\alpha\beta}\delta_{\alpha\beta}$$
$$= 2\sum_{I}\sum_{\alpha}P_{\alpha\alpha}(I) + 2\sum_{I}\sum_{J}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}P_{\alpha\beta}(I,J)S_{\alpha\beta}(I,J)$$
(4)

(интеграл перекрытия $S_{\alpha\beta}(I, J) = 1$, если $\alpha = \beta$, I = J). Таким образом, полное число электронов кластера N в приближении МО ЛКАО оказывается формально распределенным по атомам и связям между ними. Величина $P_{\alpha\alpha}(I)$ есть электронная заселенность орбитали α , центрированной на атоме I, а $2P_{ab}(I, J)S_{ab}(I, J)$ —

электронная заселенность перекрытия орбиталей *a* и *b*, центрированных на атомах *I* и *J*. В методе Малликена электронные заселенности атомов получаются путем деления заселенности перекрытия орбиталей между рассматриваемой парой атомов поровну. Тогда полное число электронов, приписываемое атому *I*, равно

$$Q = 2\sum_{\alpha} P_{\alpha\alpha}(I) + \sum_{\alpha} \sum_{\beta} P_{\alpha\beta}(I, J) S_{\alpha\beta}(I, J),$$
$$I < J, \quad \alpha < \beta.$$
(5)

Полный заряд на атоме q_I (эффективный заряд) вычисляется как разность

$$q_I = Z_I - Q_I, \tag{6}$$

где Z_I — заряд ядра атома I.

В результате расчета получались собственные значения энергии каждой молекулярной орбитали, т.е. энергетический спектр, в котором каждую молекулярную орбиталь можно представить в виде уровня. Полные плотности состояний получались после того, как каждый энергетический уровень заменялся гауссовым распределением с полушириной 0.4 эВ и интенсивности всех распределений при каждом значении энергии складывались. Парциальные вклады s- и p-состояний кремния получались аналогично, при этом учитывалось, что интенсивность каждой линии, соответствующей молекулярной орбитали, равна сумме квадратов коэффициентов в разложении молекулярных орбиталей как линейной комбинации атомных орбиталей. Для расчета теоретического фотоэлектронного спектра полуширина гауссова распределения принималась равной 0.2 эВ. Совмещение рассчитанных и экспериментальных спектров по энергетической шкале проводилось по положению главного максимума.

3. Атомная структура

3.1. Si₂₀ и Si₂₀

Кластер Si₂₀ (Si₂₀) показан на рис. 1, *а*. Структуры нейтрального и анионного кластера не имеют видимых отличий, поэтому для них мы приводим один рисунок. Атомная структура нейтрального кластера Si₂₀ имеет симметрию группы C_{2h} . Для анионного кластера структура относится к группе симметрии D_{2h} , т.е. анионный кластер имеет более высокую симметрию, чем нейтральный.

В общем случае кластер можно представить как две гексагональные антипризмы, имеющие общее основание. Внутри каждой антипризмы помещается по одному атому кремния. Внутренние атомы кремния располагаются ближе к внешним основаниям антипризм. Общее основание имеет форму вытянутого шестиугольника. Четыре стороны этого шестиугольника равны по 2.48 Å и две — по 2.54 Å. Углы соответственно также не одинаковы:



Рис. 1. Оптимизированная атомная структура кластеров $Si_{20}(Si_{20}^-)$ (*a*) и Na(K)Si₂₀ (*b*).

четыре угла по 131.76° и два по 96.34°. Внешние основания антипризм представляют собой шестиугольники, форма которых ближе к правильной. Расстояния между атомами во внешних основаниях антипризм равны по 2.52 Å. Четыре угла равны по 121.85° и два по 116.04°.

Двенадцать атомов кремния, лежащие во внешних основаниях антипризм, окружены четырьмя ближайшими соседями, а шесть атомов из центрального слоя имеют по шесть ближайших соседей. Атомы в структуре кластера образуют трехатомные кольца. В алмазной решетке *cd*-Si, как известно [11], образуются шестиатомные кольца, а в решетке клатратов — пяти- и шестиатомные [12,13]. Следует отметить, что атомная структура, полученная нами, существенно отличается от представленных, например, в работах [14–16]. Можно заметить только совпадение таких качественных особенностей, как число ближайших соседей, превышающее 4, и трехатомные кольца, которые образуют связи между атомами кремния. В работе [15] отмечается также, что стабильность сфероподобных кремниевых кластеров Si₂₀ обеспечивается за счет того, что один из атомов кремния помещается внутри полости. Аналогично и в рассчитанной нами структуре два внутренних атома кремния стабилизируют структуру кластера.

Хорошее согласие рассчитанных нами фотоэлектронных спектров кластера Si₂₀ с экспериментальными, которое будет показано далее, позволяет с высокой долей вероятности предположить, что кластеры именно с рассчитанной в представленной работе структурой детектируются в эксперименте.

3.2. NaSi₂₀ и KSi₂₀

В результате оптимизации атомной структуры кремниевых сфероидов, в которые инкапсулированы атомы натрия или калия, были получены кластеры NaSi₂₀ и KSi₂₀, имеющие форму, близкую к форме правильного додекаэдра (см. рис. 1, *b*). Структура обоих кластеров относится к группе симметрии C_1 . В начальной структуре кластера атом металла помещался в центре правильного кремниевого додекаэдра. В процессе оптимизации он сместился от центра в направлении 4-го атома кремния, что привело к деформации кремниевого сфероида, причем атом натрия сместился на большее расстояние, чем атом калия (0.22 Å против 0.17 Å). Смещение атома металла от центра кремниевых полиэдров наблюдалось экспериментально в клатрате Na₈Si₁₃₆ [17,18].

Средние межатомные расстояния Si–Si в кластерах $NaSi_{20}$ и KSi_{20} практически равны: 2.36 и 2.37 Å соответственно. Минимальные и максимальные расстояния — между атомами кремния, которые лежат в ближайших к атому металла гранях, поскольку за счет смещения атома Na(K) от центра додекаэдра эти грани сильно деформируются. Среднее расстояние Na(K)–Si в обоих кластерах составляет 3.30 Å. Максимальное расстояние Na–Si равно 3.49 Å, а наибольшее расстояние K–Si — 3.42 Å. Расстояние между атомом металла и четвертым атомом кремния — наименьшее из всех расстояний Na(K)–Si и составляет 2.67 Å в кластере $NaSi_{20}$ и 2.77 Å в кластере KSi_{20} .

Геометрия ближайшего окружения в кластерах $NaSi_{20}$ и KSi_{20} несколько отличается от геометрии в клатратах. В кремниевой решетке клатрата K_8Si_{46} , например, углы между кремниевыми связями изменяются от 108.42° до 124.20° [13]. Углы между связями Si–Si в кластере KSi_{20} меняются в интервале значений от 100.67° до 117.55° .

4. Распределение зарядов

Значения зарядов атомов в кластерах приведены в таблице. В нейтральном кремниевом кластере Si_{20} заряд распределен таким образом, что внутренние атомы Si имеют отрицательный заряд величиной -0.673e. Отрицательно заряжены также четыре из шести атомов,

| Заряд атомов (| в единицах | элементарного | заряда е) | в кластерах |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|
| $Si_{20}, Si_{20}^{-}, Na(K$ | S)Si ₂₀ | | | |

| Атом | Заряд | | | | |
|------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Si ₂₀ | Si_{20}^- | NaSi ₂₀ | KSi ₂₀ | |
| 1 | +0.180 | +0.171 | -0.019 | +0.046 | |
| 2 | +0.213 | +0.156 | -0.025 | -0.025 | |
| 3 | +0.190 | +0.072 | +0.204 | +0.086 | |
| 4 | +0.191 | +0.071 | -0.742 | -0.228 | |
| 5 | +0.211 | +0.156 | +0.188 | +0.095 | |
| 6 | +0.178 | +0.072 | -0.037 | -0.366 | |
| 7 | +0.098 | +0.111 | -0.023 | -0.033 | |
| 8 | -0.275 | -0.277 | -0.025 | -0.001 | |
| 9 | -0.311 | -0.277 | +0.190 | +0.095 | |
| 10 | +0.102 | +0.111 | -0.022 | -0.037 | |
| 11 | -0.314 | -0.276 | -0.002 | +0.068 | |
| 12 | -0.278 | -0.276 | -0.005 | +0.094 | |
| 13 | +0.180 | +0.072 | -0.013 | -0.005 | |
| 14 | +0.213 | +0.156 | -0.019 | -0.024 | |
| 15 | +0.190 | +0.071 | -0.019 | -0.008 | |
| 16 | +0.191 | +0.072 | +0.002 | -0.010 | |
| 17 | +0.210 | +0.156 | -0.001 | -0.021 | |
| 18 | +0.178 | +0.071 | -0.023 | +0.008 | |
| 19 | -0.673 | -0.656 | -0.015 | -0.005 | |
| 20 | -0.673 | -0.656 | -0.030 | -0.023 | |
| Me | — | — | +0.436 | +0.294 | |

лежащих в центральном слое. Таким образом, электронный заряд преимущественно перетекает от атомов, лежащих во внешних основаниях, к четырем атомам из центральной плоскости и к внутренним атомам.

В анионном кластере Si_{20}^- заряд внутренних атомов кремния составляет -0.656e, т.е. отрицательный заряд внутренних атомов несколько уменьшается. Полный отрицательный единичный заряд кластер имеет за счет существенного уменьшения суммарного положительного заряда внешних атомов. Отметим также, что распределение заряда в анионном кластере более симметрично, чем в нейтральном, что, очевидно, является следствием более симметричной геометрии.

В кремний-металлических кластерах Na(K)Si₂₀ кремниевый сфероид имеет отрицательный заряд, а атом металла заряжен положительно. В кластере NaSi20 этот заряд составляет 0.436*e*, а в кластере KSi₂₀ 0.294*e*. Такое распределение заряда свидетельствует о том, что атомы металлов являются донорами электронов для кремниевой решетки. Отметим, что заряд четвертого атома кремния является отрицательным и довольно существенным по модулю, -0.742е в кластере NaSi20 и -0.228e в кластере KSi₂₀ (см. рис. 1, b и таблицу), тогда как остальные атомы кремния имеют либо положительный, либо небольшой отрицательный заряд. Этот факт легко объяснить тем, что расстояние между четвертым атомом кремния и атомом металла минимально из всех расстояний Me-Si, за счет чего перенос заряда между этими атомами осуществляется легче, чем между атомом металла и другими атомами кремния.

5. Электронная структура

В результате расчетов электронной структуры кластеров нами были получены полные и парциальные плотности электронных состояний. Сопоставление рассчитанной полной плотности состояний с экспериментальным фотоэлектронным спектром для анионного кремниевого кластера [5] показано на рис. 2. Как видно из рисунка, наблюдается хорошее согласие рассчитанного спектра с полученным экспериментально.

5.1. Si₂₀ и Si₂₀

Плотности электронных состояний (DOS) нейтрального Si₂₀ и анионного Si₂₀ кремниевых кластеров идентичны, поэтому для них мы приводим один общий рисунок (см. рис. 3). Из рисунка видно, что в полосе незаполненных состояний вклад s-состояний Si незначителен и доминируют р-состояния кремния. В валентной полосе s- и p-состояния кремния сильно гибридизованы. Неодинаковое влияние s- и p-состояний Si отмечается только у потолка валентной полосы: там преобладают р-состояния. Такая ситуация принципиально отличается от наблюдаемой в кристаллическом кремнии cd-Si или в клатратах Si₄₆ и Si₁₃₆. Как известно [19-21], в полных плотностях состояний этих соединений вклады s- и *р*-состояний Si в большей степени разделены по энергии. Различие в структуре парциальных плотностей s- и р-состояний Si в кластере и в кремниевых системах cd-Si, Si₄₆ или Si₁₃₆ можно объяснить, если заметить, что в кристаллическом и клатратном кремнии каждый



Рис. 2. Экспериментальный [5] (1) и теоретический (2) фотоэлектронные спектры кластера Si_{20}^- . 3 — вклад *s*-состояний, 4 — вклад *p*-состояний кремния.

Физика и техника полупроводников, 2006, том 40, вып. 12



Рис. 3. Полные (1) и парциальные (2-4) плотности электронных состояний в кластерах Si₂₀, Si₂₀, NaSi₂₀ и KSi₂₀. 2 — вклады *s*-состояний, 3 — *p*-состояний Si, 4 — вклады *s*-состояний, 5 — *p*-состояний металла.

атом Si имеет тетраэдрическое окружение, т.е. связан с четырьмя соседними атомами. В кластерах Si_{20} и $Si_{20}^$ шесть атомов, лежащих в центральном слое, имеют по шесть ближайших соседей. За счет этого связь между ними более насыщенная, и *s*-состояния смещаются вверх по энергии.

Важной характеристикой электронной структуры кластеров является энергетическое расстояние между нижней заполненной орбиталью (НОМО-орбиталью) и верхней незаполненной орбиталью (LUMO-орбиталью), т.е. ширина щели НОМО–LUMO. В кластере Si₂₀ это расстояние составляет 3.20 эВ, а в анионном кластере 3.00 эВ.

5.2. KSi₂₀ и NaSi₂₀

Плотности электронных состояний в кластерах KSi₂₀ и NaSi₂₀ показаны на рис. 3. Профили полной плотности состояний и парциальных плотностей *s*- и *p*-состояний

Si в этих кластерах идентичны. В высокоэнергетической части валентной полосы существенно преобладает вклад *p*-состояний Si, в низкоэнергетической области несколько больше относительный вклад *s*-состояний Si. Таким образом, *s*- и *p*-состояния кремния гибридизованы слабее, чем в кластере Si₂₀, и их распределение в валентной полосе напоминает структуру валентной зоны в кристаллическом кремнии *cd*-Si и в клатратах Si₄₆ и Si₁₃₆. Такая ситуация становится понятной, если учесть, что в кремниевой решетке кластеров Na(K)Si₂₀ каждый атом кремния окружен тремя ближайшими соседями. Поэтому связи Si–Si не являются насыщенными, и валентные *s*-состояния кремния расположены преимущественно в низкоэнергетической части валентной полосы, а *p*-состояния — в высокоэнергетической.

В кремний-металлических кластерах, как и в кластере Si₂₀, в области незаполненных электронных состояний доминирует вклад *p*-состояний кремния. Заметно также влияние металлических *p*-состояний. При этом *p*-состояния Na локализованы при более высоких энергиях, чем *p*-состояния калия; *s*-состояния металла вносят небольшой вклад в высокоэнергетическую область полосы проводимости.

По сравнению с кремниевым кластером, в кластерах NaSi₂₀ и KSi₂₀ значительно сужается валентная полоса: в кремний-металлических кластерах ее ширина составляет 14 эВ против 20 эВ в кластере Si₂₀. Ширина щели HOMO–LUMO в кремний-металлических кластерах увеличивается по сравнению с кремниевым кластером: в NaSi₂₀ она составляет 4.78 эВ, в KSi₂₀ — 4.28 эВ.

6. Заключение

1. Устойчивая фуллереноподобная структура для системы из 20 атомов кремния невозможна для кремниевого кластера Si₂₀, но достигается путем стабилизации кремниевого додекаэдра атомами щелочных металлов (Na или K).

2. Перенос заряда в кремниевом кластере осуществляется как к внутренним атомам кремния, так и на поверхности кластера. В кремний-металлических кластерах атомы металла являются донорами электронов для кремниевого сфероида.

3. Вклад валентных *s*- и *p*-состояний кремния в кластере Si_{20} в полную плотность электронных состояний примерно равнозначен во всей валентной полосе. В кластерах $NaSi_{20}$ и KSi_{20} у потолка валентной полосы доминирует вклад *p*-состояний Si, а при более низких энергиях становится значительным вклад *s*-состояний. Причиной такого отличия мы считаем особенности атомной структуры кластеров.

4. Профили полной и парциальной плотностей электронных состояний в кластерах NaSi₂₀ и KSi₂₀ идентичны. Вклад состояний атомов металлов в валентной полосе кластеров пренебрежимо мал. В полосе проводимости заметен вклад *p*-состояний Na или K. Работа выполнена при финансовой поддержке Американского фонда гражданских исследований и развития для независимых государств бывшего Советского Союза (CRDF) и Министерства образования и науки РФ (грант Y2-P-10-11 программы "Фундаментальные исследования и высшее образование" (BRHE)).

Список литературы

- H.W. Kroto, J.R. Heath, S.C.O. Brien, R.F. Curl, R.E. Smalley. Nature, **318**, 162 (1985).
- [2] H. Huira, T. Miyazaki, T. Kanayama. Phys. Rev. Lett., 86, 1773 (2001).
- [3] A.K. Singh, V. Kumar, T.M. Briere, Y. Kawazoe. Nano Lett., 2, 1243 (2002).
- [4] J.S. Kasper, P. Hagenmuller, M. Pouchard, C. Cros. Science, 150, 1713 (1965).
- [5] M. Astruc Hoffmann, G. Wriggle, B.v. Issendorff, J. Muller, G. Gantefor, H. Haberrland. Eur. Phys. J., D16, 9 (2001).
- [6] M.J.S. Dewar, E.G. Zoebisch, E.F. Healy, J.J.P. Stewart. J. Amer. Chem. Soc., 107, 3902 (1985).
- [7] J.J.P. Stewart. J. Comput. Chem., 10, 209 (1989).
- [8] J.J.P. Stewart. J. Comput. Chem., 10, 221 (1989).
- [9] Полуэмпирические методы расчета электронной структуры, под ред. Дж. Сигала (М., Мир, 1980) т. 1.
- [10] С.И. Курганский, Н.А. Борщ. ФТП, 38, 580 (2004).
- [11] И.П. Шаскольская. Кристаллография (М., Высш. шк., 1976).
- [12] G.K. Ramachandran, J. Dong, J. Diefenbacher, J. Gryko, R.F. Marzke, O.F. Sankey, P.F. McMillan. J. Sol. St. Chem., 154, 716 (1999).
- [13] G.K. Ramachandran, P.F. McMillan. J. Sol. St. Chem., 154, 626 (2000).
- [14] Kai-Ming Ho, A.A. Shvartsburg, B. Pan, Z.-Y. Lu, C.-Z. Wang, J.G. Wacker, J.L. Fye, M.F. Jarrold. Nature, **392**, 582 (1998).
- [15] L. Mitas, J.C. Grossman, I. Stich, J. Tobik. Phys. Rev. Lett., 84, 1479 (2000).
- [16] Bao-xing Li, Pei-lin Cao. J. Phys.: Condens. Matter, 13, 10865 (2001).
- [17] F. Brunet, P. Melinon, A. SanMiguel, P. Keghelian, A. Perez, A.M. Frank, E. Reny, C. Cros, M. Pouchard. Phys. Rev. B, 61, 16550 (2000).
- [18] F. Tournus, B. Masenelli, P. Melinon, D. Connetable, X. Blase. Phys. Rev. B, 69, 035 208 (2004).
- [19] P. Melinon, P. Keghelian, X. Blase, J. Le Brusc, A. Perez, E. Reny, C. Cros, M. Pouchard. Phys. Rev. B, 58, 12590 (1998).
- [20] K. Moriguchi, M. Yonemura, A. Shintani, S. Yamanaka. Phys. Rev. B, 61, 9859 (2000).
- [21] A. Moewes, E.Z. Kurmaev, J.S. Tse, M. Geshi, M.J. Ferguson, V.A. Trofimova, Y.M. Yarmoshenko. Phys. Rev. B, 65, 153 106 (2002).

Редактор Т.А. Полянская

Geometrical and electronic structure of silicon and silicon-metal nanoparticles Si₂₀, Si₂₀, NaSi₂₀ and KSi₂₀

N.A. Borsch, N.S. Pereslavtseva, S.I. Kurganskii

Voronezh State University, 394006 Voronezh, Russia

Abstract Results on geometrical structure optimization and electronic structure calculation of Si_{20} , Si_{20}^- , $NaSi_{20}$ and KSi_{20} clusters are presented. In calculations, semi-empirical methods PM3 and AM1 have been used. Calculations show that atoms of Na and K have a stabilizing effect on the fullerenlike silicon structure. Influence of the clusters geometry on their electronic structure has been analyzed.